

Facteurs de procédé type	Procédé Gaz <i>i</i>								
	CF ₄	C ₂ F ₆	CHF ₃	CH ₂ F ₂	C ₃ F ₈	c-C ₄ F ₈	NF ₃ Isolé	NF ₃	SF ₆
Etch 1-U _i	0,7	0,4	0,4	S. O.	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	0,4
Etch P _{CF4}	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	S. O.	0,1	S. O.	S. O.	S. O.
Etch P _{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,1	S. O.	S. O.	S. O.
CVD 1-U _i	S. O.	0,6	S. O.	S. O.	0,1	0,1	S. O.	0,3	0,4
CVD P _{CF4}	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	0,2	0,1	S. O.	S. O.	S. O.